

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2016 年 9 月 9 日(09.09.2016)



(10) 国際公開番号

WO 2016/140113 A1

- (51) 国際特許分類:
C23C 14/34 (2006.01) H01L 21/8246 (2006.01)
C22C 19/07 (2006.01) H01L 27/105 (2006.01)
C22C 38/00 (2006.01) H01L 43/08 (2006.01)
H01F 1/14 (2006.01) H01L 43/10 (2006.01)
H01F 41/18 (2006.01) H01L 43/12 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2016/055325
- (22) 国際出願日: 2016 年 2 月 24 日(24.02.2016)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2015-042420 2015 年 3 月 4 日(04.03.2015) JP
- (71) 出願人: J X 金属株式会社(JX NIPPON MINING & METALS CORPORATION) [JP/JP]; 〒1008164 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 2 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 荒川 篤俊(ARAKAWA Atsutoshi); 〒3191535 茨城県北茨城市華川町臼場 1 8 7 番地 4 J X 金属株式会社 磯原工場内 Ibaraki (JP).
- (74) 代理人: 小越 勇, 外(OGOSHI Isamu et al.); 〒1050001 東京都港区虎ノ門 2 丁目 9 番 1 4 号 発明会館 5 階 小越国際特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーロパ (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: MAGNETIC-MATERIAL SPUTTERING TARGET AND METHOD FOR PRODUCING SAME

(54) 発明の名称: 磁性材スパッタリングターゲット及びその製造方法

(57) Abstract: A magnetic-material sputtering target according to the present invention is characterized by: being formed of a sintered body containing, at least, B, Co and/or Fe, the content of B being 10 to 50 at%; and having an oxygen content of 100 wtppm or less. Because the magnetic-material sputtering target according to the present invention can suppress the generation of particles due to oxides, it has the significant effect of enabling an improvement in yield when manufacturing magnetoresistive films and the like.

(57) 要約: Co 及び/又は Fe 並びに B を少なくとも含み、B を 10 ~ 50 at % 含有する焼結体からなり、酸素含有量が 100 wtppm 以下であることを特徴とする磁性材スパッタリングターゲット。本発明の磁性材スパッタリングターゲットは、酸化物に起因するパーティクルの発生が抑制することができるので、磁気抵抗膜等の作製時における歩留まりを向上することができるという著しい効果を有する。



WO 2016/140113 A1